

業界頂尖減排系統：DAS Environmental Experts 在半導體溫室氣體處理領域  
超越效能基準

驗證成果彰顯 DAS EE 在先進永續減排解決方案領域 35 年領導地位



德國德勒斯登，2025 年 11 月 13 日——隨著半導體產業加速邁向淨零排放目標，近期發布的 SEMI SCC 白皮書《F-GHG and Nitrous Oxide 半導體減排技術綜覽》(2024)為溫室氣體減排樹立了全新產業績效基準。該報告為 CF<sub>4</sub> 設定最低破壞與清除效率（DRE）為>95%，並為製程氣體減排系統訂定最高目標值為>99%。

這些新基準顯著超越了多數 ESG 報告與供應商要求沿用的傳統假設——過往多採用保守預設值評估溫室氣體處理效能。然而，即使 SEMI SCC 目標的上限範圍仍未完全展現現代技術的潛力。

DAS Environmental Expert GmbH 透過其 TILIA 減排系統證明，實現 CF<sub>4</sub>及其他含氟溫室氣體超過 99.9%的破壞效率不僅技術可行，更具經濟效益。此類系統不僅超越 SEMI SCC 白皮書設定的基準，更能直接助力產業碳減排目標。

「TILIA 等系統證明超越現行產業基準不僅可行，更具經濟合理性，」 DAS Environmental Expert GmbH 廢氣處理部營運長 Stephan Raithel 表示。「隨著碳稅攀升與永續目標趨嚴，投資高效減排技術將直接轉化為營運與財務效益。」

全球半導體產業每年排放數千噸 CF<sub>4</sub>，此氣體的全球暖化潛勢（GWP）高達 7,390。即使僅數噸未經處理的排放量，亦相當於數百萬噸 CO<sub>2</sub>當量。當前產業實務雖以達成 SCC 建議的最低除碳效率（DRE）為目標，**唯有持續維持 99.9%以上除碳效率的系統**，方能協助產業實現淨零承諾。

**SEMI SCC 白皮書**強調，實現更高效率對產業永續發展藍圖至關重要，需廣泛採用新一代減排技術。DAS Environmental Experts 經實證的 TILIA 平台正是此轉型典範——為半導體產業樹立「業界最佳」減排效能的新標竿。

## 關於 DAS

DAS Environmental Experts Group（DAS 集團）總部位於德國德勒斯登，創立於 1991 年，現已發展為全球性組織，於三大洲設有分公司，全球員工逾 950 名。過去三十年間，DAS 集團已成為廢氣處理解決方案的頂尖技術與設備供應商，專注服務半導體產業。

此外，DAS 集團亦開發工業水處理的先進製程與系統解決方案，在半導體產業廢水回收再利用領域擁有深厚專業技術。

DAS 解決方案專為滿足半導體製造的嚴苛純度要求而設計，協助客戶符合全球環境標準。

聯絡我們：

Daniela Georgi

Head of Corporate Communications

DAS Environmental Experts

電子郵件：[media@das-ee.com](mailto:media@das-ee.com)

網站：<https://www.das-ee.com/en/>